

南台科技大學 102 學年度第 1 學期課程資訊

課程名稱	真空技術及半導體設備
課程編碼	L0N06901
系所代碼	0L
開課班級	夜四技光電三甲 夜四技光電四甲
開課教師	古鎮豪
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	四 14 五 13 14 教室 J206
必選修	選修
課程概述	介紹各種業界常用之半導體製程設備，並認識和設備相關之元件、物理、製程、材料和廠務
課程目標	使同學對目前在提煉矽晶圓到晶圓加工製程中之各種半導體製程設備有深入之了解
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 晶圓成長和晶圓製作 2. 磊晶沉積設備 3. 微影照像設備 4. 化學氣相沉積爐 5. 氧化擴散高溫爐 6. 離子植入機 7. 乾蝕刻機 8. 蒸鍍機 9. 濺鍍機 10. 化學機械研磨
英文大綱	
教學方式	
評量方法	
指定用書	真空技術與應用
參考書籍	
先修科目	
教學資源	
注意事項	<p>分組報告題目:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 化學氣相沉積(Cheical Vapor Deposition, CVD) 2. 物理氣相沉積(Physical Vapor Deposition, PVD) 3. 爐管(Furnace) 4. 擴散與退火(Diffusion and Anneal) 5. 離子佈植(Ion Implantation) 6. 快速加熱(Rapid Thermal Processing, RTP)

	7. 乾蝕刻(Dry Etching)
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	